



CAS IR Grid / 微电子研究所 / 中国科学院微电子研究所 / EDA中心

## 28nm及特色先导工艺集成电路设计产业化关键技术与应用

文献类型: 成果

**作者** 王海永<sup>1</sup>; 陈岚<sup>1</sup>; 尹明会<sup>1</sup>; 秦毅<sup>1</sup>; 张贺<sup>1</sup>; 徐勤志<sup>1</sup>

**获奖日期** 2018

**文献子类** 北京市科学技术奖

**奖励等级** 三等奖

**源URL** [http://159.226.55.107/handle/172511/19287]

**专题** 微电子研究所\_EDA中心

**作者单位** 中国科学院微电子研究所

**推荐引用方式** 王海永,陈岚,尹明会,等. 28nm及特色先导工艺集成电路设计产业化关键技术与应用. . 2018.  
**GB/T 7714**

入库方式: OAI收割

来源: [微电子研究所](#)

浏览

65

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。